

## 研究評価委員会におけるコメント

第37回研究評価委員会（平成25年12月4日開催）に諮り、以下のコメントを評価報告書へ附記することで確定した。

### 1. ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発／①ヒト幹細胞実用化に向けた評価基盤技術の開発（中間評価）

- ◆ ES細胞やiPS細胞では、その分化誘導が一番難しいので、更に力を入れるべき。

### 2. 次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発（中間評価）

- ◆ 本プロジェクトの範囲を超えるが、この10年数多くのナショナルプロジェクトを行ってきたものの、日本の半導体産業は落ちる一方だという現実に対し、今後のナショナルプロジェクトのあり方を議論すべきではないか。

### 3. 次世代プリントドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発（中間評価）

- ◆ プリントドエレクトロニクス分野は、まだ日本の技術が世界をリードしている分野であるが、大量の資金導入をもとに諸外国が虎視眈々と日本の技術による実用化を狙っている。今後は、技術開発とビジネスをどのように一体化して進めて行くかが重要である。